

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 6 月 6 日 (2019.6.6)

【公開番号】特開 2017-191202 (P2017-191202A)

【公開日】平成 29 年 10 月 19 日 (2017.10.19)

【年通号数】公開・登録公報 2017-040

【出願番号】特願 2016-80324 (P2016-80324)

【国際特許分類】

G 0 2 F 1/155 (2006.01)

G 0 2 F 1/15 (2019.01)

G 0 2 F 1/19 (2019.01)

【F I】

G 0 2 F 1/155

G 0 2 F 1/15 5 0 5

G 0 2 F 1/19

【手続補正書】

【提出日】平成 31 年 4 月 10 日 (2019.4.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

対向配置される第 1 および第 2 の基板と、

前記第 1 の基板の、前記第 2 の基板との対向面に配置される第 1 の電極であって、表面に一体的に形成された凸凹構造を含む第 1 の電極と、

前記第 2 の基板の、前記第 1 の基板との対向面に配置される第 2 の電極と、

前記第 1 および第 2 の基板の間隙に、銀を含むエレクトロデポジション材料を含有する電解質層と、

を有し、

前記第 1 の電極は、前記第 1 の基板の表面の一部を露出して配置されており、

前記第 1 の基板において、前記第 1 の電極から露出している部分の表面にも、凸凹構造が設けられている、

光学素子。

【請求項 2】

前記第 1 の基板と前記第 1 の電極との接触界面は、相対的に平坦である請求項 1 記載の光学素子。

【請求項 3】

前記第 1 の基板と前記第 1 の電極との接触界面も、凸凹である請求項 1 記載の光学素子。

【請求項 4】

前記第 1 の電極の凸凹構造の算術平均粗さは、20 nm ~ 30 nm である、請求項 1 ~ 3 いずれか 1 項記載の光学素子。

【請求項 5】

第 1 の基板に、表面が平坦な第 1 の電極を形成する工程と、

前記第 1 の基板の前記第 1 の電極側から、プラスト法またはエッチング法により、凸凹構造を形成する工程と、

第 2 の基板に、第 2 の電極を形成する工程と、
銀を含むエレクトロデポジション材料を含有する電解質層を挟んで、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを、前記第 1 の電極と前記第 2 の電極が対向するように重ね合わせる工程と、
を有する光学素子の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の主な観点によれば、対向配置される第 1 および第 2 の基板と、前記第 1 の基板の、前記第 2 の基板との対向面に配置される第 1 の電極であって、表面に一体的に形成された凸凹構造を含む第 1 の電極と、前記第 2 の基板の、前記第 1 の基板との対向面に配置される第 2 の電極と、前記第 1 および第 2 の基板の間に、銀を含むエレクトロデポジション材料を含有する電解質層と、を有し、前記第 1 の電極は、前記第 1 の基板の表面の一部を露出して配置されており、前記第 1 の基板において、前記第 1 の電極から露出している部分の表面は、相対的に凸凹である、光学素子、が提供される。